

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第1区分
【発行日】平成18年6月15日(2006.6.15)

【公開番号】特開2004-157135(P2004-157135A)
【公開日】平成16年6月3日(2004.6.3)
【年通号数】公開・登録公報2004-021
【出願番号】特願2004-10030(P2004-10030)
【国際特許分類】

G 0 1 N 23/225 (2006.01)

H 0 1 J 37/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 23/225

H 0 1 J 37/28 B

H 0 1 L 21/66 J

【手続補正書】

【提出日】平成18年4月25日(2006.4.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

試料にパターンが形成された基板表面を電子線で走査する工程と、試料に電圧を印加する工程と、上記電子線により上記基板表面から二次的に発生する信号を検出する工程と、検出された信号から該基板表面の電子線画像を形成する工程と、該電子線画像を記憶する工程とを有し、前記記憶した画像より欠陥を判定する工程を含む検査方法であって、被検査回路パターンに応じて前記基板表面へ入射させる電子線照射条件を見い出す工程を含むことを特徴とする回路パターンの検査方法。